ชื่อเรื่อง การศึกษาเชลแสงอาทิตย์แบบซิลิกอนที่โดปด้วยฟอสฟอรัส ชื่อผู้เขียน นายเปี้ยม แก้วสวัสดิ์ การคันควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนพิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527

## บทกัดยอ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมและสึกษาพารามิเตอร์ตาง ๆ ของเซลแสง อาทิตย์แบบซิลิกอนชุดหนึ่ง โดยใช้แวนผล็กเชิงเดียวของซิลิกอนชนิดพีที่โดปดวยโบรอน ซึ่ง มีสภาพตานทานเป็น 0.006, 0.065, 0.12 และ 30 โอห์ม-เซนติเมตร สำหรับเป็น สารเริ่มต้น การเตรียมหัวต่อพีเอ็นทำโดยวิธีการทาผิวหน้าของแผนซิลิกอนกั้วยกรดฟอสฟอุริด แล้วนำไปทำให้เกิดการแพร่ซึมที่อุณหภูมิ 900-950 ซี เป็นเวลานานตาง ๆ กันอยู่ในช่วง 20-3600 นาที่ ความลึกของหัวต่อที่ได้อยู่ในช่วง 0.19-0.75 ไมครอน สภาพตานทาน. ของชั้นที่ถูกแพรซึมเมื่อวัดด้วย four point probe พบวามีคาอยู่ในช่วง 0.35-1.59 โอห์ม-เซนติเมตร จากนั้นจึงนำไปสรางกริดและชั่วสัมผัสโดยการระเหยในสูญญากาศของ แผนโลหะ เงินลงบนผิวหน้าของเซล ส่วนสายไฟที่ตอกับชั่วไฟฟ้าของเซลใช้ตะกัวบัดกรีเชา ในภายหลัง จากผลการทดลองที่ได้จากการศึกษาเซลที่สรางขึ้น พบวาคาพิลแฟดเตอร์และ ค่า junction perfection factor อยู่ในช่วง 0.3-0.5 และ 2.1-3.3 ตามลำดับ คาดวามตานทานอนุกรมอยู่ในช่วง 5.2-16,6 โอหม ส่วนกากวามหนาแนนของกระแสลัด วงจรและกาประสิทธิภาพของเซล เมื่อสังเกตที่ความเขมของแสง 1000 วัตต์/ตารางเมตร จากหลอดไฟไส์ทั้งสเตน พบวามีกาอยู่ในช่วง 0.16-23.4 มิลลิแอมแปร์/ตารางเซนติเมตร และ 0.2-4.9 % ตามลำดับ เมื่อทุดลองเอาเซลบางอันมาวางกลางแสงอาทิตย์ที่มีความ เข้มเทากับที่ได้จากหลอดไฟพบว่า คาความหนาแนนกระแสลัดวงจรและประสิทธิภาพของ เซลจะ เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ขนาดของความลึกหัวตอที่ทำให้เซลมีประสิทธิภาพสูงอยู่ในช่วง 0.47-0.53 ไมครอน

Research Title

A Study of Phosphorus Doped Silicon Solar Cell

Name

Mr. Piem Keowsawaedi

Research For

Master of Science in Teaching Physics

Chiang Mai University 1984

## Abstract

In this work a series of silicon solar cells was fabricated and their characteristic parameters were studied. The starting materials were p-type single crystal silicon wafers, doped with boron, having resistivities 0.006, 0.065, 0.12 and 30  $\Omega$ .cm. P-n junctions were prepared by means of painting on the wafer surfaces with phosphoric acid and solid diffusion was carried out in the temperature range of 900-950°C for time intervals in the range of 20-3600 minutes. The corresponding junction depths obtained from the diffusion were ranging from 0.19-0.75/um. Resistivities of diffused layers were observed by means of the four point probe to be in the range of 0.35-1.59 Ω.cm. Ohmic contacts and grid fingers attached to the cells were prepared by means of vacuum deposition of silver and electrical wire connections were made later on with the general purpose solder. Consider from the experimental results, it was observed that fill factors and junction perfection factors of the cells were in the range of 0.3-0.5 and 2.1-3.3 respectively. While their series resistances were ranging from  $5.2-16.6^{\Omega}$ . Exposure to light intensity of 1000 W/m2 generated by a tungsten filament bulb, it was found that their short circuit current densities and their efficiency were in the range of 1.6-23.4 mA/cm<sup>2</sup> and 0.2-4.9% respectively. Slightly higher values of short circuit current densitites and cell efficiency were observed in some of the cells which were exposed to the solar radiation at the same intensity. The optimum junction depth for high efficiency cells was found to be in the range of 0.47-0.53 jum.

ผู้เขียนขอขอบพระกุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นิกร มังกรทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ผ่องศ์รี มังกรทอง ที่ใค้กรุณาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชีก จนการวิจัยสำเร็จลูลวงไปค้วยกี ขอขอบพระกุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศร สิงขรัตน์ ภากวิชาพิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์อารีย์ วิเชียรฉาย อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตลาดกระบัง อาจารย์สุรพล ศรีแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานกรินทร์ ที่ให้คำแนะนำที่มี ประโยชน์ต่องานวิจัยอย่างมาก ขอขอบคุณภากวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสศึกษาอุปกรณ์และให้ใช้เครื่องมือบางอย่างในงานวิจัยนี้ และ ขอขอบคุณ กุณพิจิตร สุริมล ที่ให้การช่วยเหลือในด้วนเอกสารด้วยกี่ตลอดมา

> เปี้ยม แก้วสวัสดิ์ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2527

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved